

## 金属靶材

金属靶材是高速荷能粒子轰击的目标材料，其主要特征包括高纯度、高均匀性、大尺寸和复杂结构，通过磁控溅射（直流）镀膜技术可形成超硬、耐磨、防腐等特性的金属膜层，主要应用于半导体芯片制造、显示屏制造、光伏电池封装、光学镀膜与装饰镀膜等领域。

磁控溅射具有沉积温度低、沉积速度快、所沉积的薄膜均匀性好、成分接近靶材成分等优点。其沉积速率快、沉积效率高，适合工业生产大规模应用，且基片温度低，适合塑料等不耐高温的基材镀膜。制备的薄膜纯度高、致密性好、膜基结合力强，可制备金属、合金、氧化物等多种薄膜，且环保无污染。

| 材料    | 纯度          | 最大尺寸      | 制备方法  | 备注       |
|-------|-------------|-----------|-------|----------|
| Al    | 3~5N        | 300×300mm | 熔炼    | 厚度根据要求定制 |
| Ag    | 4N          | 300×300mm | 熔炼    | 厚度根据要求定制 |
| Au    | 4N          | 300×300mm | 熔炼    | 厚度根据要求定制 |
| C 石墨) | 3N          | 300×300mm | 特殊烧结  | 厚度根据要求定制 |
| Co    | 3N          | 300×300mm | 熔炼    | 厚度根据要求定制 |
| Cr    | 2N5~3N5     | 200×200mm | 特殊烧结  | 厚度根据要求定制 |
| Cu    | 3N7         | 300×300mm | 熔炼    | 厚度根据要求定制 |
| Fe    | 2N5,3N,4N   | 300×300mm | 熔炼    | 厚度根据要求定制 |
| Ge    | 4N          | Dia300mm  | 特殊烧结  | 厚度根据要求定制 |
| Hf    | 3N          | 100×100mm | 熔炼    | 厚度根据要求定制 |
| In    | 4N          | 300×300mm | 熔炼    | 厚度根据要求定制 |
| Mg    | 3N5         | 300×300mm | 熔炼    | 厚度根据要求定制 |
| Mo    | 3N5         | 300×300mm | 特殊烧结  | 厚度根据要求定制 |
| Ni    | 2N5,3N5,4N5 | 300×300mm | 熔炼    | 厚度根据要求定制 |
| Pb    | 3N,4N       | 300×300mm | 熔炼    | 厚度根据要求定制 |
| Si    | 5N          | 300×300mm | 特殊烧结  | 厚度根据要求定制 |
| Sn    | 3N5,5N      | 300×300mm | 熔炼    | 厚度根据要求定制 |
| Ta    | 3N5         | 300×300mm | 熔炼    | 厚度根据要求定制 |
| Ti    | 2N5,3N      | 300×300mm | 熔炼    | 厚度根据要求定制 |
| V     | 2N5,3N      | 300×300mm | 熔炼    | 厚度根据要求定制 |
| W     | 3N5         | 300×300mm | 熔炼    | 厚度根据要求定制 |
| Zn    | 3N,4N       | 300×300mm | 熔炼    | 厚度根据要求定制 |
| Zr    | 3N          | 300×300mm | 熔炼    | 厚度根据要求定制 |
| ..... | .....       | .....     | ..... | .....    |